Боковой перенос энергии при возбуждении плазмонов терагерцовой волной в периодической пространственно несимметричной графеновой структуре

© Д.В. Фатеев^{1,2}, К.В. Машинский¹, И.М. Моисеенко¹, В.В. Попов¹

¹ Саратовский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук, 410019 Саратов, Россия

² Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского,

410012 Саратов, Россия

E-mail: FateevDV@yandex.ru

Поступила в Редакцию 24 апреля 2019 г. В окончательной редакции 29 апреля 2019 г. Принята к публикации 29 апреля 2019 г.

> Теоретически исследовано преобразование мощности терагерцовой волны, нормально падающей на периодическую графеновую структуру, в мощность бегущей плазменной волны. Найдены режимы максимального преобразования мощности падающего излучения в мощность бегущего плазмона и режим возбуждения однонаправленно бегущего плазмона. Выяснено, что до 15% мощности падающей волны может преобразоваться в мощность бегущего плазмона.

Ключевые слова: плазмон, терагерцовое излучение, графен, бегущая волна.

DOI: 10.21883/FTP.2019.09.48122.05

1. Введение

В последнее время интенсивно исследуются плазмонные свойства графена в терагерцовом (ТГц) частотном диапазоне [1–3]. В настоящее время современные технологии позволяют создавать графеновые структуры с подвижностью носителей заряда ~ 100 000 см²/(B · c) и временем релаксации импульса носителей ~ $\tau = 1$ пс при комнатных температурах [4], что соответствует теоретическим предсказаниям [5,6]. Указанные значения времени релаксации импульса позволяют возбуждать плазмонные резонансы на ТГц частотах.

Обычно для возбуждения плазмонных резонансов в графене используются короткопериодические решетки, позволяющие связать медленные дифракционные гармоники электрического поля [7] с медленными плазмонными модами в графене [8]. При таком способе возбуждения, как правило, возбуждаются стоячие плазменные волны. Для возбуждения бегущих плазменных волн в графене используются дифракция электромагнитной волны на одиночных объектах, таких как: 1) острие сканирующего ближнеполевого микроскопа [9], одиночный металлический затвор, расположенный над графеном [10], щель в металлическом экране, расположенном над графеном [11]. Еще одним способом возбуждения бегущего плазмона является использование постоянного дрейфа в графене в периодических структурах [12]. Наконец следует упомянуть способы возбуждения бегущего плазмона в графене с помощью эффекта нарушенного полного внутреннего отражения с использование призм [13,14].

В данной работе исследуется преобразование ТГц волны, нормально падающей на периодическую графеновую структуру с асимметричной элементарной ячейкой, в бегущую плазменную волну в графене.

Постановка задачи и метод решения

Рассматриваемая структура (рис. 1) состоит из графена, над которым расположен двойной решеточный металлический затвор с асимметричной элементарной ячейкой. Структура расположена на полубесконечной диэлектрической подложке. Терагерцовая волна, с поляризацией электрического поля поперек полосок решетки, падает на решеточный затвор и возбуждает плазменные колебания в графене. За счет создания геометрической асимметрии элементарной ячейки графеновой структуры возможно возбуждение плазменной волны с неравными встречными пространственными фурье-гармониками порядков +p и -p [15], что может приводить к возбуждению бегущей плазменной волны и к возникновению эффектов увлечения носителей заряда



Рис. 1. Схематическое изображение периодической графеновой структуры с двойным решеточным затвором (показаны две элементарные ячейки). На рисунке справа показаны потоки мощности в структуре.

в графене бегущей плазменной волной [15,16]. В расчетах использовалось значение энергии Ферми носителей заряда в графене 150 мэВ.

Для моделирования возбуждения бегущей плазменной волны в периодической структуре была решена электродинамическая задача о нормальном падении однородной ТГц электромагнитной волны на рассматриваемую структуру. На первом этапе электродинамического подхода уравнения Максвелла в трех диэлектрических средах записываются в фурье-представлении, с разложением всех компонент индуцированных электрического и магнитного полей в ряды Фурье как

$$E_x(x, z, t) = \exp(-i\omega t) \sum_{p=-\infty}^{\infty} e_{x,p}(z) \exp(iq_p x),$$

где $E_x(x, z, t)$ — x-компонета электрического поля, $e_{x,p}(z)$ — фурье-амплитуды и $q_p = 2\pi p/L$ — векторы обратной решетки, p — целое число и L — пространственный период графеновой структуры. Зависимость индуцированных электрических полей от координаты z в диэлектрических средах записывалась в виде

$$\begin{aligned} e_{x,p}^{(1)}(z) &= e_{x,p}^{(1)} \exp(iq_{z,p}^{(1)}z), \\ e_{x,p}^{(2)}(z) &= e_{x,p}^{(2,1)} \exp(iq_{z,p}^{(2)}z) + e_{x,p}^{(2,2)} \exp(-iq_{z,p}^{(2)}z), \\ e_{x,p}^{(3)}(z) &= e_{x,p}^{(3)} \exp(iq_{z,p}^{(3)}z), \end{aligned}$$
(1)

где $e_{x,p}^{(\alpha)}(z)$ — фурье-амплитуды электрического поля в различных диэлектрических средах, $q_{z,p}^{(\alpha)} = \pm \sqrt{\omega^2 \varepsilon_{\alpha} \varepsilon_{0} \mu_{0} - q_{p}^2}$ — поперечные волновые числа пространственных фурье-гармоник и $\alpha = 1, 2, 3$ номер среды. Связь электрических и магнитных полей в различных диэлектрических средах описывается граничными условиями в плоскостях z = d и z = 0, в виде

$$\begin{cases} e_{x,p}^{(1)}(d) + \delta_{p,0} E_x^{\text{inc}}(d) = e_{x,p}^{(2)}(d), \\ h_{y,p}^{(1)}(d) + \delta_{p,0} H_y^{\text{inc}}(d) - h_{y,p}^{(2)}(d) = -j_{x,p}(d), \\ e_{x,p}^{(2)}(0) = e_{x,p}^{(3)}(0), \\ h_{y,p}^{(2)}(0) - h_{y,p}^{(3)}(0) = -\sigma_{\text{gr}}(\omega) e_{x,p}^{(2)}(0), \end{cases}$$

$$(2)$$

где $j_{x,p}(d)$ — фурье-амплитуды электрического тока в плоскости металлического затвора z = d, $\sigma_{gr}(\omega)$ проводимость графена, описываемая формулой [17,18]

$$\sigma_{\rm gr}(\omega) = \frac{e^2 2\tau \, k_{\rm B}T}{\pi \hbar^2 (1 - i\omega\tau)} \ln\left(2 \operatorname{ch}\left(\frac{\varepsilon_{\rm F}}{2k_{\rm B}T}\right)\right) + \frac{e^2}{4\hbar^2} \, Q\left(\frac{\hbar\omega}{2}\right) - \frac{e^2\omega}{i\pi} \int_0^\infty \frac{Q(\varepsilon) - Q\left(\frac{\hbar\omega}{2}\right)}{\hbar^2 \omega^2 - 4\varepsilon^2} \, d\varepsilon, \quad (3)$$
$$Q(\vartheta) = \frac{\operatorname{sh}\left(\frac{\vartheta}{k_{\rm B}T}\right)}{\operatorname{ch}\left(\frac{\vartheta}{k_{\rm B}T}\right) + \operatorname{ch}\left(\frac{\varepsilon_{\rm F}}{k_{\rm B}T}\right)}.$$

Здесь $\varepsilon_{\rm F}$ — энергия Ферми в графене, e — заряд электрона, $k_{\rm B}$ — постоянная Больцмана и T — температура.

С использованием уравнений Максвелла и граничных условий в фурье-представлении можно записать соотношение между фурье-амплитудами электрического поля и плотности тока в плоскости z = d

$$e_{x,p}^{(1)}(d) = Z_P(\sigma_{\rm gr}) j_d$$
$$- \left(2\sqrt{\frac{\varepsilon_0\varepsilon_1}{\mu_0}} Z_0(\sigma_{\rm gr}) e^{-id\omega\sqrt{\varepsilon_0\mu_0\varepsilon_1}} + 1\right) \delta_{p,0} E_x^{\rm inc}, \quad (4)$$

где

(1)

$$Z_p(\sigma_{\rm gr}) = -\frac{q_{z,0}^{(1)}q_{z,0}^{(2)}(t_2q_{z,0}^{(3)}\varepsilon_0\varepsilon_2\omega - t_1q_{z,0}^{(2)}t_3)}{\varepsilon_0\chi\omega}$$

 фурье-импедансы графеновой структуры в плоскости решеточного затвора, при получении которых использовались следующие величины:

$$\begin{split} \chi &= (\xi_2 q_{z,0}^{(1)} \varepsilon_2 - \xi_1 q_{z,0}^{(2)} \varepsilon_1) q_{z,0}^{(2)} \xi_3 + (\xi_2 q_{z,0}^{(2)} \varepsilon_1 \\ &- \xi_1 q_{z,0}^{(1)} \varepsilon_2) \varepsilon_0 \omega q_{z,0}^{(3)} \varepsilon_2, \\ \xi_1 &= -1 + e_{z,0}^{2idq^{(2)}}, \quad \xi_2 = 1 + e_{z,0}^{2idq^{(2)}}, \quad \xi_3 = q_{z,0}^{(3)} \sigma_{\rm gr} - \varepsilon_0 \varepsilon_3 \omega. \end{split}$$

На втором этапе электродинамического подхода формируются интегральные уравнения относительно осциллирующих токов в плоскости z = d. Для этого используется закон Ома в виде

$$I_x(x,d) = \sigma(x,d)E_x(x,d),$$
(5)

где $I_x(x, d) = \sigma(x, d)E_x(x, d)$ — плотность электрического тока в плоскости решеточного затвора, и

$$\sigma(x, d) = \begin{cases} \sigma_{\rm M} & \text{при } 0 < x < w_1, \\ 0 & \text{при } w_1 < x < w_1 + w_2, \\ \sigma_{\rm M} & \text{при } w_1 + w_2 < x < w_1 + w_2 + w_3, \\ 0 & \text{при } w_1 + w_2 + w_3 < x < L, \end{cases}$$
(6)

где $\sigma_{\rm M}$ — поверхностная проводимость металла. Используя выражения (4)—(6) и обратное преобразование Фурье для плотности электрического тока, можно записать два связанных интегральных уравнения относительно плотностей электрических токов на затворных электродах элементарной ячейки решеточного затвора:

$$I_{x}^{(w_{1})}(x,d) - \sigma_{M} 2 \sqrt{\frac{\varepsilon_{0}\varepsilon_{1}}{\mu_{0}}} \exp\left(-i\omega d\sqrt{\varepsilon_{0}\mu_{0}\varepsilon_{1}}\right) Z_{0} E_{x}^{inc}$$

$$= \int_{0}^{w_{1}} I_{x}^{(w_{1})}(x',d) G(x,x') dx' + \int_{w_{1}+s_{1}}^{w_{1}+s_{1}+w_{2}} I_{x}^{(w_{2})}(x',d) G(x,x') dx',$$

$$I_{x}^{(w_{2})}(x,d) - \sigma_{M} 2 \sqrt{\frac{\varepsilon_{0}\varepsilon_{1}}{\mu_{0}}} \exp\left(-i\omega d\sqrt{\varepsilon_{0}\mu_{0}\varepsilon_{1}}\right) Z_{0} E_{x}^{inc}$$

$$= \int_{0}^{w_{1}} I_{x}^{(w_{1})}(x',d) G(x,x') dx' + \int_{w_{1}+s_{1}}^{w_{1}+s_{1}+w_{2}} I_{x}^{(w_{2})}(x',d) G(x,x') dx',$$
(7)

Физика и техника полупроводников, 2019, том 53, вып. 9

где $I_x^{(w_1)}(x, d)$ — плотность тока на затворном электроде с шириной $w_1, I_x^{(w_2)}(x, d)$ — плотность тока на затворном электроде с шириной w_2 и

$$G(x, x') = \frac{1}{L} \sigma_{\mathrm{M}} \sum_{p=-\infty}^{\infty} Z_{P}(\sigma_{\mathrm{gr}}) \exp(iq_{P}(x - x'))$$

ядра интегралов.

На следующем этапе электродинамического подхода система интегральных уравнений (7) решается методом Галеркина с помощью разложения плотностей электричесекого тока в ряды по ортогональным полиномам Лежандра:

$$I_{x}^{(w_{1})}(x,d) = \sum_{\beta=0}^{\infty} C_{\beta}^{(1)} P_{\beta} \left(\frac{2x}{w_{1}} - 1\right),$$

$$I_{x}^{(w_{2})}(x,d) = \sum_{\beta=0}^{\infty} C_{\beta}^{(2)} P_{\beta} \left(2\frac{x - w_{1} - s_{1}}{w_{2}} - 1\right), \qquad (8)$$

где $C_{\beta}^{(n)}$ — коэффициенты разложения и P_{β} — полиномы Лежандра.

Подстановка выражений (8) в (7) преобразует систему интегральных уравнений в систему алгебраических уравнений относительно неизвестных коэффициентов $C_{\beta}^{(n)}$, которая решается численно. Решение алгебраической системы позволяет вычислить плотности токов на решеточном затворе, используя выражения (8), и электрические поля и токи во всех точках элементарной ячейки графеновой структуры с помощью выражений (4), граничных условий (2) и уравнений Максвелла.

Для вычисления потоков энергии в графеновой структуре использован усредненный по времени вектор Умова-Пойнтинга $S = 0.5 \text{ Re}[EH^*]$, где E — вектор электрического поля и H — вектор магнитного поля. Поскольку при выбранной поляризации падающей волны будут возбуждаться только TM дифракционные поля с компонентами (E_x, E_z, H_y), то вектор потока Умова-Пойнтинга будет иметь только две компоненты

$$S_x = -\frac{1}{2} \operatorname{Re}(E_z H_y^*),$$

$$S_z = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(E_x H_y^*).$$

Вычислим поток мощности падающей волны как

$$S_z^{\rm inc} = -\frac{1}{2} \sqrt{\frac{\varepsilon_1 \varepsilon_0}{\mu_0}} |E_x^{\rm inc}|^2$$

поток мощности отраженной от графеновой структуры волны как

$$S_z^{\mathbf{R}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\varepsilon_1 \varepsilon_0}{\mu_0}} |e_{x,0}^{(1)}|^2$$

и поток мощности прошедшей через графеновую структуру волны как

$$S_{z}^{\mathrm{T}} = -\frac{1}{2} \sqrt{\frac{\varepsilon_{3}\varepsilon_{0}}{\mu_{0}}} |e_{x,0}^{(3)}|^{2}$$

Физика и техника полупроводников, 2019, том 53, вып. 9

Тогда коэффициент поглощения ТГц волны в графеновой структуре может быть записан как

$$A = 1 - \frac{S_z^T + S_z^R}{S_z^{\text{inc}}}.$$

Усредненный по пространственному периоду структуры поток электромагнитной мощности вдоль графена (в *x*-направлении), возникающий в результате возбуждения бегущей плазменной волны, может выть вычислен как

$$S_x^P = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{0}^{L} S_x dx dz.$$
(9)

Интегрирование по координате z учитывает вклад всех высших эванесцентных фурье-гармоник электромагнитного поля плазмона. Поток мощности плазмона (9) может быть записан как сумма двух встречных потоков $S_x^P = S_x^{P+} + S_x^{P-}$, один из которых (S_x^{P+}) направлен в положительном направлении оси x, а другой — в отрицательном (S_x^{P-}) , при этом каждый из них должен суммировать потоки во всех трех средах

$$S_x^{P+} = S_x^{P1+} + S_x^{P2+} + S_x^{P3+},$$

$$S_x^{P-} = S_x^{P1-} + S_x^{P2-} + S_x^{P3-}.$$

Вклады потоков Умова-Пойнтинга различных направлений в различных средах вычисляются с помощью следующих выражений:

$$\begin{split} S_x^{P1+} &= \frac{\omega \varepsilon_1 \varepsilon_0}{4} \sum_{p>0} \frac{q_p}{|q_{z,p}^{(1)}|^2} \frac{\beta_p^{(1)} |e_{x,p}^{(1)}|^2}{\mathrm{Im}(q_{z,p}^{(1)})}, \\ S_x^{P2+} &= \frac{\omega \varepsilon_2 \varepsilon_0}{4} \sum_{p>0} \frac{q_p}{|q_{z,p}^{(2)}|^2} \frac{\beta_p^{(2,2)} |e_{x,p}^{(2,2)}|^2 - \beta_p^{(2,1)} |e_{x,p}^{(2,1)}|^2}{\mathrm{Im}(q_{z,p}^{(2)})} \\ &- \omega \varepsilon_2 \varepsilon_0 d \sum_{p>0} \frac{q_p}{|q_{z,p}^{(2)}|^2} \operatorname{Re}\left(e_{x,p}^{(2,1)}(e_{x,p}^{(2,2)})^*\right), \\ S_x^{P3} &= \frac{\omega \varepsilon_3 \varepsilon_0}{4} \sum_{p>0} \frac{q_p}{|q_{z,p}^{(3)}|^2} \frac{|e_{x,p}^{(3)}|^2}{-\mathrm{Im}(q_{z,p}^{(3)})} \\ S_x^{P1-} &= \frac{\omega \varepsilon_1 \varepsilon_0}{4} \sum_{p>0} \frac{q_p}{|q_{z,p}^{(1)}|^2} \frac{\beta_p^{(1)} |e_{x,p}^{(1)}|^2}{|x_{z,p}^{(1)}|^2}, \end{split}$$

И

$$\begin{split} \mathbf{q} &= \frac{|q_{z,p}^{2}|^{2}}{|m(q_{z,p}^{2})|^{2}} \lim(q_{z,p}^{2}) \\ S_{x}^{P2-} &= \frac{\omega\varepsilon_{2}\varepsilon_{0}}{4} \sum_{p<0} \frac{q_{p}}{|q_{z,p}^{(2)}|^{2}} \frac{\beta_{p}^{(2,2)}|e_{x,p}^{(2,2)}|^{2} - \beta_{p}^{(2,1)}|e_{x,p}^{(2,1)}|^{2}}{\operatorname{Im}(q_{z,p}^{(2)})} \\ &- \omega\varepsilon_{2}\varepsilon_{0}d \sum_{p<0} \frac{q_{p}}{|q_{z,p}^{(2)}|^{2}} \operatorname{Re}\left(e_{x,p}^{(2,1)}(e_{x,p}^{(2,2)})^{*}\right), \\ &S_{x}^{P3-} &= \frac{\omega\varepsilon_{3}\varepsilon_{0}}{4} \sum_{p<0} \frac{q_{p}}{|q_{z,p}^{(3)}|^{2}} \frac{|e_{x,p}^{(3)}|^{2}}{-\operatorname{Im}(q_{z,p}^{(3)})}, \end{split}$$

где

$$\begin{split} \beta_p^{(1)} &= \exp \left(-2 \operatorname{Im}(q_{z,p}^{(1)}) d \right), \\ \beta_p^{(2,n)} &= \exp \left((-1)^n 2 \operatorname{Im}(q_{z,p}^{(2)}) d \right) - 1. \end{split}$$

Для описания эффективности преобразования мощности падающей ТГц волны в бегущую плазменную волну вводится коэффициент $T_P = S_x^P / |S_{L,x}^{inc}|$, где $S_{L,x}^{inc} = LS_z^{inc}$ — плотность потока падающей волны на элементарную ячейку периодической структуры. Тогда коэффициент преобразования $T_P^+ = S_x^{P+} / |S_{L,z}^{inc}|$ будет описывать преобразование падающей электромагнитной волны в плазмон, переносящий энергию в положительном направлении оси x, а коэффициент преобразования $T_P^- = S_x^{P-} / |S_{L,z}^{inc}|$ будет соответствовать отрицательному направлению оси x.

3. Результаты расчетов и их обсуждение

При расчетах использовались следующие параметры графеновой структуры: $w_2 = 0.5$ мкм, $s_1 = 0.25$ мкм, $s_2 = 0.1$ мкм, d = 25 нм. В рассматриваемой графеновой структуре возможно возбуждение так называемых "подзатворных" плазмонов, волновые вектора которых квантуются как $k_x = \pi n/w_l$ (для l = 1, 2), где w_l — ширины различных затворных электродов в элементарной ячейке и п — целое число. В пространственно симметричной структуре только радиационные плазмонные моды (c n = 1, 3, 5, ...) могут возбуждаться падающей волной. В то время как в пространственно асимметричной структуре возможно возбуждение "нерадиационных" плазмонных мод (с n = 2, 4, 6, ...) [15]. В рассматриваемой графеновой структуре было исследовано преобразование падающей электромагнитной ТГц волны в бегущий плазмон при возбуждении "подзатворных" плазмонных



Рис. 2. Спектр коффициента поглощения периодической графеновой структуры A в засимости от ширины затворного электрода w_1 .



Рис. 3. Спектры коэффициентов преобразования мощности падающей волны в мощность бегущего плазмона T_P, T_P^+ , и T_P^- при ширине затворного электрода $w_1 = 0.656$ мкм. Кривая коэффициента поглощения A графеновой структуры в нижней части рисунка получена как сечение рис. 2 при $w_1 = 0.656$ мкм. На вставке в верхней части рисунка показано пространственное распределение плотности осциллирующего тока в элементарной ячейке графена в плазмонном резонансе на частоте 3.4 ГГц при $w_1 = 0.656$ мкм.

мод с различными $k_x = \pi n/w_l$. На рис. 2 показана зависимость спектра коэффициента поглощения в графеновой структуре от ширины затворного электрода w_1 . Плазмонные моды, коэффициент поглощения которых не зависит от w_1 , резонансно возбуждаются под затворным электродом w_2 , и моды, для которых частота обратно пропорциональна ширине затворного электрода w_2 , возбуждаются под затворным электродом w_2 (рис. 2). Наиболее эффективными с точки зрения увеличения коэффициента преобразования падающей ТГц волны в бегущий плазмон Т_Р являются такие плазмонные резонансы, когда под одним затворным электродом резонансно возбуждается "радиационная" плазмонная мода с волновым вектором $k_x = \pi/w_2$, а под другим затворным электродом — "нерадиационная" плазмонная мода с волновым вектором $k_x = \pi 2/w_1$ (на рис. 2 показаны две такие точки): 1) на частоте 3.4 ТГц и $w_1 = 0.656$ мкм и 2) на частоте 4.1 ТГц и $w_1 = 0.36$ мкм). При расчетах произведена оптимизация графеновой структуры для получения наибольшего коэффициента преобразования T_P на частоте 3.4 ТГц при $w_1 = 0.656$ мкм по параметрам w_2 , d и коэффициенту асимметрии $K = 1 - s_1/s_2$, при постоянной сумме $s_1 + s_2$.

Максимально достижимый коэффициент преобразования в этом случае составил 15% для времени релаксации импульса носителей заряда 1 пс (рис. 3) и коэффициента асимметрии K = 0.6. При возбуждении такого плазмонного резонанса потоки мощности в положительном T_p^+ и отрицательном T_p^- направлении оси x испытывают резонанс и отличаются друг от друга в 2 раза (рис. 3). Пространственное распределение E_x компоненты электрического поля в графене для плазмонной моды с

максимальным коэффициентом преобразования показано на вставке к рис. 3, где показано одновременное возбуждение "радиационной" и "нерадиационной" плазмонных мод.

Максимальное различие между потоками мощности плазмона в положительном T_p^+ и отрицательном $T_p^$ направлении оси x (рис. 4) можно наблюдать при резонансном возбуждении только "нерадиационной" подзатворной моды. Графеновая структура была оптимизирована по параметрам s_1, s_2, w_2, d и коэффициенту асимметрии К в целях увеличения коэффициента преобразования мощности в однонаправленно распространяющийся плазмон. На рис. 4 показаны резонансы возбуждения двух "нерадиационных" мод с волновым вектором



Рис. 4. Зависимость коэффициентов преобразования мощности падающей волны в мощность бегущего плазмона T_P , T_P^+ и T_P^- от ширины затворного электрода w_1 на частоте 4.875 ТГц. Кривая коэффициента поглощения A графеновой структуры в нижней части рисунка получена как сечение рис. 2 на частоте 4.875 ТГц.



Рис. 5. Пространственное распределение плотности осциллирующего тока в элементарной ячейке графена при резонансном возбуждении "нерадиационной" плазмонной моды с волновым вектором $k_x = 2\pi/w_1$ на частоте 4.875 ТГц при $w_1 = 0.404$ мкм.

Физика и техника полупроводников, 2019, том 53, вып. 9



Рис. 6. Пространственное распределение плотности осциллирующего тока в элементарной ячейке графена при резонансном возбуждении "нерадиационной" плазмонной моды с волновым вектором $k_x = 4\pi/w_1$ на частоте 4.875 ТГц при $w_1 = 0.872$ мкм.

 $k_x = 2\pi/w_1$ и $w_1 = 0.404$ мкм и волновым вектором $k_x = 4\pi/w_1$ и $w_1 = 0.872$ мкм на частоте 4.875 ТГц. Максимальное преобразование мощности в однонаправленный плазмон происходит при возбуждении "нерадиационной" моды с волновым вектором $k_x = 4\pi/w_1$ (рис. 2 на частоте 4.875 ТГц и $w_1 = 0.872$ мкм) при коэффициенте асимметрии графеновой структуры K = 0.6(рис. 4). Выяснено, что в этом случае, несмотря на сравнительно небольшой коэффициент преобразования мощности падающей волны в бегущую мощность плазмона T_P, разница между потоками мощности плазмона T_{P}^{+} и T_{P}^{-} может превышать порядок величины (рис. 4 при $w_1 = 0.872$ мкм). Пространственное распределение компоненты электрического поля в графене для "нерадиационной" плазмонной моды с волновым вектором $k_x = 2\pi/w_1$ показано на рис. 5, а для плазмонной моды с волновым вектором $k_x = 4\pi/w_1$ — на рис. 6.

4. Заключение

Таким образом, в данной работе показано, что в периодической графеновой структуре с двойным решеточным затвором и асимметричной элементарной ячейкой возможно возбуждение бегущих плазмонных мод внешней ТГц волной, нормально падающей на плоскость структуры. Наибольший коэффициент преобразования мощности падающей волны в бегущий плазмон достигается при одновременном резонансном возбуждении "радиационной" и "нерадиационной" плазмонных мод под разными затворными электродами в элементарной ячейке структуры.

При резонансном возбуждении только "нерадиационной" плазмонной моды в графеновой структуре мощность падающей волны преобразуется в однонаправленно бегущий плазмон. Причем различие между встречными потоками мощности плазмона может составлять больше порядка величины.

Финансирование работы

Работа поддержана Российским научным фондом, грант № 18-79-10041.

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Список литературы

- A.N. Grigorenko, M. Polini, K.S. Novoselov. Nature Photonics, 6, 749 (2012).
- [2] F.H.L. Koppens, T. Mueller, P. Avouris, A.C. Ferrari, M.S. Vitiello, M. Polini. Nature Nanotech., 9, 780 (2014).
- [3] F.J. García de Abajo. ACS Photonics, 1, 135 (2014).
- [4] A.K. Geim, I.V. Grigorieva. Nature, 499, 419 (2013).
- [5] D. Svintsov, V. Vyurkov, S. Yurchenko, T. Otsuji, V. Ryzhii. J. Appl. Phys., **111**, 083715 (2012).
- [6] T. Zhao, S. Gong, M. Hu, R. Zhong, D. Liu, X. Chen, P. Zhang, X. Wang, C. Zhang, P. Wu, S. Liu. Scientific Rep., 5, 16059 (2015).
- [7] H. Yan, T. Low, W. Zhu, Y. Wu, M. Freitag, X. Li, F. Guinea, P. Avouris, F. Xia. Nature Photonics, 7, 394 (2013).
- [8] B. Wunsch, T. Stauber, F. Sols, F. Guinea. New J. Phys., 8, 318 (2006).
- [9] P. Alonso-Gonzalez, A.Y. Nikitin, Y. Gao, A. Woessner, M.B. Lundeberg, A. Principi, N. Forcellini, W. Yan, S. Velez, A.J. Huber, K. Watanabe, T. Taniguchi, F. Casanova, L.E. Hueso, M. Polini, J. Hone, F.H.L. Koppens, R. Hillenbrand. Nature Nanotech., 12, 31 (2017).
- [10] N. Kumada, S. Tanabe, H. Hibino, H. Kamata, M. Hashisaka, K. Muraki, T. Fujisawa. Nature Commun., 4, 1363, (2013).
- [11] L. Du, D. Tang. J. Optical Soc. America A, 31, 691 (2014).
- [12] T. Wenger, G. Viola, J. Kinaret, M. Fogelstrom, P. Tassin. Phys. Rev. B, 97, 085419 (2018).
- [13] Y.V. Bludov, M.I. Vasilevskiy, N.M.R. Peres. J. Appl. Phys., 112, 084320 (2012).
- [14] A.Y. Nikitin, P. Alonso-Gonzalez, R. Hillenbrand. Nano Lett., 14, 2896 (2014).
- [15] V.V. Popov, D.V. Fateev, E.L. Ivchenko, S.D. Ganichev. Phys. Rev. B, 91, 235436 (2015).
- [16] D.V. Fateev, K.V. Mashinsky, V.V. Popov. Appl. Phys. Lett., 110, 061106 (2017).
- [17] L.A. Falkovsky, A.A. Varlamov. Eur. Phys. J. B, 56, 281 (2007).
- [18] M.S. Jang, V.W. Brar, M.C. Sherrott, J.J. Lopez, L. Kim, S. Kim, M. Choi, H.A. Atwater. Phys. Rev. B, 90, 165409 (2014).

Редактор Г.А. Оганесян

Lateral energy transfer by plasmons excited by a terahertz wave in a periodic spatially asymmetric graphene structure

D.V. Fateev^{1,2}, K.V. Mashinsky¹, I.M. Moiseenko¹, V.V. Popov¹

 ¹ Kotelnikov Institute of Radio Engineering and Electronics, Russian Academy of Sciences, 410019 Saratov, Russia
 ² Saratov State University, 410012 Saratov, Russia

Abstract The transformation of the power of terahertz wave normally incident onto a periodic graphene structure into the power of propagating plasmon is studied theoretically. The regime of the maximum transformation of the power of the incident radiation into the power of a traveling plasmon and the regime of the excitation of a unidirectional-traveling plasmon are found. It was shown that up to 15% of the power of the incident wave can be transformed into a propagating plasmon.